(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



T TERRE BENERAL E BERNE HAR BOND BRIEF BIN 1 I HILL BRIEF HREI BRIEF BRIEF BIND BIN BERREN 1801 HAR FAR HAR F

(43) 国際公開日 2005 年3 月31 日 (31.03.2005) ´

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/029166 A1

(51) 国際特許分類7:

G02F 1/13, 1/1339

5458522 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 Osaka (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/012727

(72) 発明者; および

(22) 国際出願日:

2004年9月2日(02.09.2004)

(75) 発明者/出願人 *(*米国についてのみ*)*: 甲斐田 一弥 (KAIDA, Kazuya) [JP/JP]; 〒6310804 奈良県奈良市神功六丁目 3-2-6 2 7 Nara (JP). 泉 明範 (IZUMI, Akinori) [JP/JP]; 〒5150818 三重県松阪市川井町

4 9 7 – 3 Mie (JP).

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

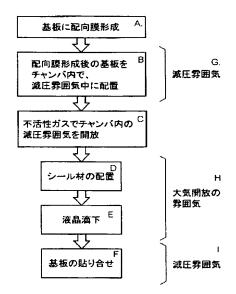
特願2003-331418 ′ 2003 年9 月24 日 (24.09.2003) / JF 特願2003-331419 ′ 2003 年9 月24 日 (24.09.2003) / JF (74) 代理人: 深見 久郎, 外(FUKAMI, Hisao et al.); 〒 5300054 大阪府大阪市北区南森町2丁目1番29号 三井住友銀行南森町ビル 深見特許事務所 Osaka (JP).

(71) 出願人 /米国を除く全ての指定国について): シャープ 株式会社 (SHARP KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

[続葉有]

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL AND APPARATUS FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL PRODUCTION

(54) 発明の名称: 液晶表示パネルの製造方法および液晶表示パネルの製造装置



- A...FORM ALIGNMENT LAYER ON SUBSTRATE
- B...DISPOSE SUBSTRATE AFTER ALIGNMENT LAYER FORMATION IN VACUUM ATMOSPHERE WITHIN CHAMBER
- C...RELEASE VACUUM ATMOSPHERE WITHIN CHAMBER WITH INERT GAS
- D...DISPOSE SEALANT
- E...DROP LIQUID CRYSTAL
- F...BOND SUBSTRATES TO EACH OTHER
- G...VACUUM ATMOSPHERE
- H...ATMOSPHERE OF OPEN ROOM AIR
- I...VACUUM ATMOSPHERE

(57) Abstract: A process for producing a liquid crystal display panel, comprising the step of disposing a sealant on the major surface of either or both of two substrates to be bonded together, the step of dropping a liquid crystal onto either of the two substrates and the step of bonding the two substrates to each other, which process further comprises, to be conducted prior to the liquid crystal dropping step, the deaeration step of disposing at least a substrate on which the liquid crystal is to be dropped of the two substrates in a vacuum atmosphere and, to be conducted prior to the bonding step, the opening step of releasing the vacuum atmosphere with inert gas. Alternatively, the process further comprises, to be conducted prior to the sealant disposing step, the deaeration step of disposing at least a substrate on which the sealant is to be disposed of the two substrates in a vacuum atmosphere and, to be conducted prior to the bonding step, the opening step of releasing the vacuum atmosphere with inert gas.

DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 一 補正書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。